(12) 특허협력조약에 의하여 공개된 국제출원

(19) 세계지식재산권기구
국제사무국

(43) 국제공개일
2022 년 7 월 7 일 (07.07.2022)

WIPO | PCT

(10) 국제공개번호
WO 2022/146060 A1

(51) 국제특허분류:
H01L 21/67 (2006.01) *H01S 5/40* (2006.01)
G01J 5/0802 (2022.01) *H01L 21/687* (2006.01)
H01S 5/183 (2006.01)

(21) 국제출원번호: PCT/KR2021/020231

(22) 국제출원일: 2021 년 12 월 29 일 (29.12.2021)

(25) 출원언어: 한국어

(26) 공개언어: 한국어

(30) 우선권정보:
10-2020-0185839 2020 년 12 월 29 일 (29.12.2020) KR

(71) 출원인: 주식회사 비아트론 (VIATRON CO., LTD) [KR/KR]; 16648 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 139, Gyeonggi-do (KR).

(72) 발명자: 김태형 (KIM, Tae Hyeong); 16463 경기도 수원시 팔달구 향교로 122, 504, Gyeonggi-do (KR). 이주미 (LEE, Ju Mi); 16600 경기도 수원시 권선구 평동로 77번길 14-2, 502호, Gyeonggi-do (KR). 정병규 (JEONG, Byeong Gyu); 61754 광주시 남구 효천2로 1, 101동 401호, Gwangju (KR).

(74) 대리인: 김호종 (KIM, Ho Jong); 06234 서울시 강남구 테헤란로 8길 11-4, 신도빌딩4층, Seoul (KR).

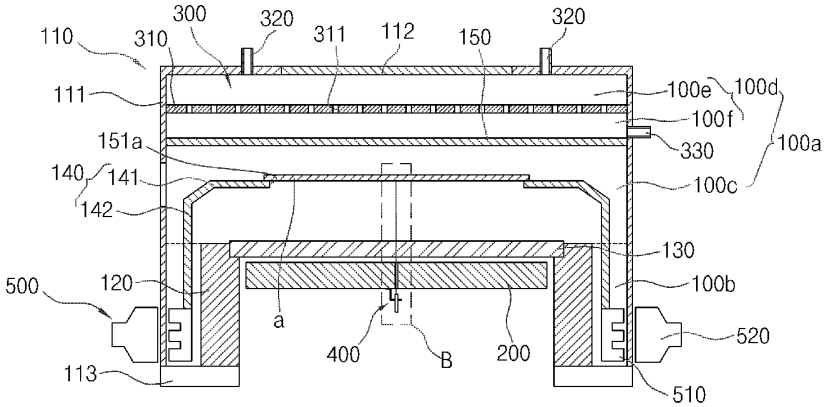
(81) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 국내 권리의 보호를 위하여): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 역내 권리의 보호를 위하여): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 유라시아 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 유럽 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

공개:
— 국제조사보고서와 함께 (조약 제21조(3))

(54) Title: SUBSTRATE HEAT-TREATMENT DEVICE USING LASER-LIGHT-EMITTING DEVICE

(54) 발명의 명칭: 레이저 발광 소자를 이용한 기판 열처리 장치



(57) Abstract: The present invention provides a substrate heat-treatment device comprising: a process chamber in which a flat substrate to be heat-treated is positioned, and which has a beam transmission plate positioned below the flat substrate and an infrared transmission plate positioned on the flat substrate; a beam emission module for emitting a laser beam at the lower surface of the flat substrate through the beam transmission plate; and a temperature measurement module for measuring the temperature of the lower surface or the upper surface of the flat substrate.

(57) 요약서: 본 발명은 내부에 열처리되는 평판 기판이 위치하고 평판 기판의 하부에 위치하는 빔 투과판과 평판 기판의 상부에 위치하는 적외선 투과판을 구비하는 공정 챔버와, 빔 투과판을 통하여 평판 기판의 하면으로 레이저 빔을 조사하는 빔 조사 모듈 및 평판 기판의 하면 또는 상면의 온도를 측정하는 온도 측정 모듈을 포함하는 것을 기판 열처리 장치를 개시한다.

WO 2022/146060 A1